

「後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発」(事後評価)
今後の予定

平成 27 年 6 月 5 日 (金) 10:00~17:00

評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成 27 年 6 月 9 日 (火)

質問票の提出 (評価委員)

提出先: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 渡邊 繁幸 宛

※質問票への回答 (推進・実施者) は 6 月 12 日 (金) までに評価部 渡邊へ提出

評価コメントの作成・取り纏め

平成 27 年 6 月 17 日 (水)

評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)

提出先: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 渡邊 繁幸 宛

平成 27 年 7 月 1 日 (水) 頃まで

評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 27 年 7 月 9 日 (木) 頃まで

評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、推進・実施者に配布

評価コメント応答

平成 27 年 7 月 17 日 (金) 頃まで

推進・実施者意見書 (事実誤認の確認、補足説明) の作成 (推進・実施者)

平成 27 年 7 月 24 日 (金)

推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定 (分科会長・評価委員)

評価報告書の確定

平成 27 年 10 月~平成 27 年 12 月頃 (予定)

研究評価委員会にて評価報告書 (案) を審議、承認の上、確定。